

第183回講演会

【開催：平成25年5月16日（木）】

主催 中国地区化学工学懇話会

下記の要領で講演会を開催します。多数の方のご参加を頂きますようお願い致します。

記

日 時：平成25年5月16日（木）15：00～17：00

場 所：広島大学 工学部 117講義室

交 通：山陽本線西条駅下車、バス15分、大学会館前下車
山陽新幹線東広島駅下車、タクシー10分
広島バスセンターから直行バス約1時間、大学会館前下車

講 演1：「ポリシルセスキオキサン系ハイブリッド材料の創製」

講 師1：郡司 天博 氏

東京理科大学 理工学部 工業化学科 教授

講演内容：ポリシルセスキオキサンは三官能性シランの反応により合成され、その主鎖構造により非晶質型、かご型、はしご型に分類される。ポリシルセスキオキサンはシリカとシリコーンの中間的な性質を有するので、その合成や応用について大いに興味を持たれている化合物である。本講演では、かご型ポリシルセスキオキサンの合成とその応用に関する最新の成果とともに、非晶質型ポリシルセスキオキサンを用いた有機-無機ハイブリッド材料の合成と物性評価を紹介する。

講 演2：「低速陽電子消滅法による機能性薄膜のナノ構造解析」

講 師2：伊藤 賢志 氏

産業技術総合研究所 計測標準研究部門 ナノ材料計測科

ナノ構造化材料研究室 研究室長

講演内容：物質中の分子のすき間（サブナノおよびナノメートルスケールの空間）は物理化学的性質に影響するため、次世代半導体用層間絶縁膜、燃料電池用電解質膜や水処理用分離膜など局所空間を制御したナノ構造化膜材料の研究開発が進んでいる。本講演では、低速陽電子消滅法による水処理用分離膜の細孔構造解析への応用例や、新規開発した大気中で適用可能な寿命測定システムによる親水性高分子薄膜中の自由体積空隙の環境湿度応答性のその場評価例を紹介する。

参加費：無料

申込先：FAX または電子メールでお申し込み下さい。

中国地区化学工学懇話会

TEL 082-424-7718 FAX 082-424-5494 E-mail (ysasa@hiroshima-u.ac.jp)